

بهینه سازی عملکرد لیزر نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP با معرفی ساختار موجبری نامتقارن سه گانه اکستریم

زهرا دانش کفتروودی^۱

دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، گروه علوم مهندسی، رودسر، واجارگاه.

دریافت: ۱۳۹۹/۷/۳۰

پذیرش: ۱۴۰۳/۹/۱۰

چکیده

در این مقاله، بهبود عملکرد لیزر نیمه رسانای قرمز مبتنی بر AlGaInP برای اولین بار با معرفی ساختار جدید موجبر نامتقارن سه گانه ای اکستریم بررسی شده است. در ساختار موجبر پیشنهادی جدید برای تغییر ساختار یک لیزر متقارن مرسوم، در گام نخست، ضخامت‌های لایه‌ی موجبر و غلاف آلائیده نوع n افزایش یافته است و پس از آن، برای طراحی لایه‌های غلاف و موجبر آلائیده نوع p در ساختار لیزر نیمه رسانای قرمز، یک نامتقارنی سه گانه در نظر گرفته شده است. عملکرد ساختار متقارن مرسوم و ساختار جدید نامتقارن سه گانه ای اکستریم به صورت تئوری در نرم‌افزار PICS3D انجام شده است. شبیه‌سازی‌های سه بعدی انتقال حامل، موجبری نوری و خودگرمایشی به صورت خودسازگار در نرم‌افزار ترکیب شده اند. نتایج شبیه‌سازی حاکی از بهبود قابل توجه عملکرد لیزر در نامتقارن پیشنهادی جدید در مقایسه با ساختار متقارن مرسوم هستند. دلایل بهبود عملکرد لیزر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که استفاده از ساختار جدید منجر به کاهش همپوشانی مد نوری با نواحی با آلایش بالا می‌گردد. از طرف دیگر با کاهش جریان نشتی الکترون‌ها، افزایش در آهنگ بازنگرهای القایی رخ می‌دهد که این منجر به کاهش جریان آستانه، افزایش توان خروجی می‌گردد. با کاهش مقاومت سری و افزایش پایداری حرارتی ساختار پیشنهادی جدید، بهینگی این ساختار تایید می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: لیزر دیود مبتنی بر AlGaInP، شبیه‌سازی، توان، جریان آستانه، موجبر نامتقارن

.PICS3D، سه گانه ای اکستریم،

^۱zahraadanesh@guilan.ac.ir نویسنده مسئول

۱- مقدمه

لیزرهای نیمه رسانا یکی از ادوات کارآمد در تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی نوری هستند و به همین دلیل در فن آوریهای پیشرفته نوری، از عناصر اصلی محسوب می‌شوند^[۱]. در این بین، لیزرهای نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP با طول موج خروجی ۶۶ نانومتر افزارهای کلیدی برای استفاده به عنوان منابع نوری در سیستم‌های اپتیکی کاربردی برای دیسک‌های چندکاره‌ی دیجیتالی قابل ضبط و قابل نوشتن هستند. در این سیستم‌ها ضبط با سرعت بالا مورد نیاز است، بنابراین، توان نوری پرتوی لیزری که بر روی دیسک متمرکز می‌شود برای تامین این نیاز باید افزایش یابد. برای دستیابی به این امر، لیزرهای نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP با کارآیی بالا مورد نیاز هستند^[۲].

لیزرهای نیمه رسانا معمولاً از کلاوک نوری^۱ بزرگ با ساختارهای محدود‌کننده‌ی مجزایی^۲ استفاده می‌کنند که از موجبرهای متقارن تشکیل می‌شوند. این موجبرهای پهن متقارن توسط لایه‌های غلاف^۳ با آلائیدگی p و n با ترکیب مادی نیمه رسانی مشابه در لایه‌های مذکور ساخته می‌شوند. در لیزرهای توان بالا که بسیار بالاتر از سطح آستانه کار می‌کنند، مشخصه‌ی بسیار مهم عملکرد لیزر، کارآیی بالای آن در جریان‌های تزریقی پایین است. اما، در جریان تزریقی بسیار بالا، به دلیل گرمایش لیزر در موجبرهای پهن، کاهش توان رخ میدهد^[۳]. طراحی موجبر متقارن بسته به کاربرد مورد نظر لیزر قابل بهینه‌سازی است. یک رویکرد برای حل این مساله که به صورت تجربی توسط بودا^۴ برای لیزرهای نیمه رسانا با طول موج خروجی nm ۸۲۶ انجام شده است، شامل تغییر تقارن موجبر در لیزر مذکور می‌شود. در ساختار موجبر پیشنهادی او، همپوشانی مد نوری با لایه غلاف با آلایش نوع p که دارای جذب نوری بسیار بالا است، کاهش یافته است^[۴]. در سال‌های اخیر، به طور موفقیت‌آمیزی از ساختارهای موجبری نامقارن دوگانه‌ی اکستریم (EDAS)^۵ برای لیزرهای توان بالا با چاه‌های کوانتومی InGaAs در طول موج nm ۹۴۰ استفاده شده است^[۵]. در ساختارهای EDAS، ضخامت لایه‌ی غلاف با آلایش نوع n افزایش داده می‌شود. علاوه بر این، اختلاف ضریب شکست موجود بین لایه‌های موجبر و غلاف نوع n بسیار کمتر از این اختلاف در لایه‌های غلاف و موجبر نوع p است. ضخامت لایه‌ی غلاف نوع p نیز کاهش داده می‌شود، تا با کاهش اختلاف نوری ناشی از جذب، کارآیی لیزر نیمه رسانا افزایش چشمگیری یابد. علاوه بر این با کاهش ضخامت لایه غلاف نوع p مقاومت الکتریکی لیزر تا حد زیادی کاهش می‌یابد که منجر به بهبود عملکرد لیزر می‌شود. اما، این امر موجب افزایش جریان آستانه به

¹ Optical Cavity

² Separate Confinement

³ Cladding layer

⁴ Buda

⁵ Extreme Double Asymmetric

دلیل کاهش شدید همپوشانی مدنوری با ناحیه‌ی فعال (کاهش بهره نوری) می‌گردد. این تحقیقات بر روی موجبرهای نامتقارن حاکی از اهمیت بهینه‌سازی طراحی موجبر برای بهبود عملکرد لیزر است. روش پیشنهادی جدید در این مقاله برای کاهش جریان آستانه عبارت است از ساختار نامتقارن سه‌گانه‌ی اکستروم (ETAS)^۱. در این ساختار نامتقارن، در گام نخست، طول لایه‌ی غلاف نوع n افزایش داده می‌شود و نامتقارنی سه‌گانه بر روی طراحی لایه‌های نیمه رسانای استفاده شده در ساختار جدید معرفی می‌گردد^[۷].

یافتن بهترین و کارآمدترین ساختارها برای لیزرهای نیمه رسانا کاری نیست که بتواند به راحتی و تنها بصورت تجربی صورت گیرد. مدل‌سازی محاسباتی اخیراً به عنوان رویکردی مقرون‌به‌صرفه در راستای طراحی لیزرهای نیمه رسانای جدید و همچنین پیش‌بینی مشخصات آن‌ها به کار برد می‌شود.^[۸]

در این مطالعه، دو لیزر نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP^۲ بررسی شده اند تا توان خروجی لیزر با جریان آستانه و ولتاژ کار قابل قبولی ایجاد شود. اول، لیزر چاه کوانتموی متقارن مرسوم پیشنهاد شده و با استفاده از PICS3D^۳ شبیه‌سازی شده است. این نرم افزار یک شبیه‌ساز سه بعدی برای طراحی لیزرهای نیمه رسانا و سایر ادوات فوتونیکی با ناحیه فعال است^[۹]. این شبیه‌ساز به‌طور خودسازگار^۴ شبیه‌سازی سه بعدی انتقال حامل، موجبری نوری و خودگرمایش را با یکدیگر ترکیب می‌کند. در ادامه، نشان داده شده است که لیزر نیمه رسانا با ساختار جدید نامتقارن سه‌گانه‌ی اکستروم با خصوصیات بهبود یافته دارای جریان آستانه و مقاومت سری کاهش یافته، توان خروجی و بازده شبیه افزایش یافته و پایداری حرارتی بهبود یافته است. در ساختار موجبر پیشنهادی جدید، ابتدا، ضخامت لایه‌های موجبر و غلاف نوع n افزایش داده شده است و پس از آن، نامتقارنی سه‌گانه در طراحی لایه‌های غلاف و موجبر نوع n و نوع p در ساختار لیزر نیمه رسانا در نظر گرفته شده است. ساختار این مقاله به شرح زیر است.

در بخش‌های دوم و سوم، به ترتیب، ساختار لیزر، مدل‌های نظری و پارامترهای مادی بکار رفته در این تحقیق معرفی شده اند. بخش چهارم به ارائه نتایج شبیه‌سازی و بحث اختصاص داده شده است.

۲- ساختار لیزر

لیزر متقارن از لایه‌ی بافر^۵ n-Al_{0.7}Ga_{0.3}As با ضخامت μm ۰,۳، لایه‌ی غلاف μm ۰,۵ با ضخامت سه‌گانه^۶ n-(Al_{0.5}Ga_{0.5})_{۰,۵}In_{۰,۵}P^۷ با ضخامت μm ۱ تشكیل شده است. ناحیه فعال شامل سه چاه کوانتموی کرنش یافته In_{۰,۵۵}Ga_{۰,۴۵}P با ضخامت μm ۰,۰۵ و سدهای (Al_{0,۵}Ga_{۰,۵})_{۰,۵}In_{۰,۵}P با ضخامت μm ۰,۰۱ شود. لایه‌ی موجبر p-(Al_{0,۷}Ga_{۰,۳})_{۰,۵}In_{۰,۵}P با ضخامت μm ۰,۱ در ساختار قرار داده شده اند. طول ۲ و لایه‌ی پوشش^۸ p-Al_{0,۷}Ga_{۰,۳}As با آلایش بالا و ضخامت μm ۰,۱ در ساختار قرار داده شده اند.

Extreme Triple Asymmetric Structure^۱

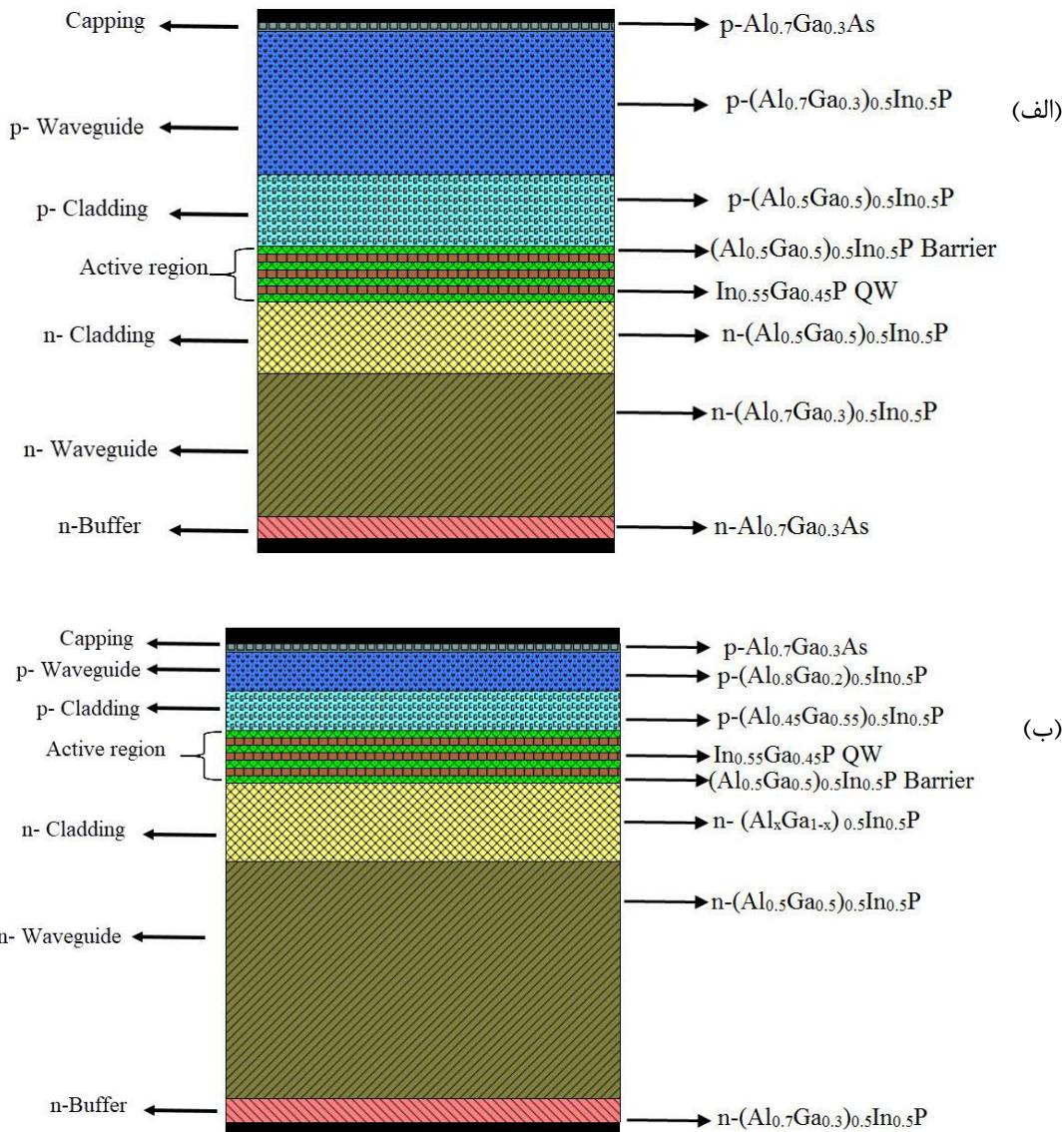
^۲ Photonic Integrated Circuit Simulator in 3D

^۳ Self-Consistent

^۴ Buffer

^۵ Capping

کاواک فابری - پرو^۱ برابر با μm ۴۰۰ در نظر گرفته شده است. هر دو رخ لیزر دارای انعکاس ۵۲٪ هستند. در ساختار نامتقارن سه گانه اکسترمیم، ضخامت لایه‌های غلاف $\text{p-(Al}_{0.8}\text{Ga}_{0.2})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$, موجبر و غلاف $\text{p-Al}_{0.7}\text{Ga}_{0.3}\text{As}$ ^۲ به ترتیب برابر با ۰,۵ و ۳ میکرومتر هستند. ترکیب لایه‌ی موجبر $\text{p-(Al}_{x}\text{Ga}_{1-x})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ دارای گریدینگ خطی^۲ از $x = 0,5$ تا $0,7$ است. بخش‌های دیگر ساختار لیزر متقارن در لیزر پیشنهادی نامتقارن جدید بدون تغییر باقی مانده است. شکل ۱ ساختارهای متقارن و ETAS را نشان می‌دهد.



شکل ۱. ساختار شماتیک (الف) لیزر با موجبر متقارن و (ب) لیزر با موجبر ETADS

^۱ Fabry-Perot

^۲ Linear Graded

۳- مدل تئوری و پارامترهای مادی

از شبیه‌ساز PICS3D برای تحلیل، طراحی و بهینه‌سازی ساختارهای پیشنهادی استفاده می‌شود. معادلات اصلی که رفتار الکتریکی نیمه هادی را توصیف می‌کنند رابطه‌ی پواسون^۱ (۱) همراه با معادلات پیوستگی جریان^۲ (۲) و (۳) برای الکترون‌ها و حفره هستند [۱۰]:

$$-\nabla \cdot \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon_{dc}}{q} \nabla V \right) = -n + p + N_D (1 - f_D) - N_A + \sum_j N_t (\delta_j - f_{tj}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_n - \sum_j R_n^{tj} - R_{sp} - R_{st} - R_{Aug} + G_{opt}(t) = \frac{\partial n}{\partial t} + N_D \frac{\partial f_D}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_p + \sum_j R_p^{tj} + R_{sp} + R_{st} + R_{Aug} - G_{opt}(t) = -\frac{\partial P}{\partial t} + N_A \frac{\partial f_A}{\partial t} \quad (3)$$

در رابطه‌ی (۱) ϵ_0 و ϵ_{dc} به ترتیب ضریب گذردهی مربوط به خلا و دیالکتریک هستند. همچنین، n و p تراکم الکترون‌ها و حفره‌ها هستند. N_A و N_D چگالی ناخالصی‌های سطحی دهنده و گیرنده هستند. δ_j چگالی j امین تله عمیق است، f_A و f_D به ترتیب ترازهای فرمی ناخالصی‌های دهنده و گیرنده هستند و f_{tj} تراز فرمی j امین تله‌ی عمیق است. در روابط (۲) و (۳)، G_{opt} آهنگ تولید فوتون در واحد حجم است. همچنین، R_{sp} ، R_{st} و R_{Aug} به ترتیب آهنگ بازترکیب‌های القایی^۳، خودبخودی^۴ و اوژه^۵ هستند [۱۰]. برای در نظر گرفتن ویژگی‌های نوری لیزر نیمه‌هادی یعنی توزیع میدان نوری و تعداد فوتون‌ها در کاواک لیزر، معادله‌ی موج اسکالر مختلط و معادله‌ی آهنگ تغییرات فوتون حل می‌شوند. بهره‌ی نوری بر مبنای مدل گذار بین نواری^۶ محاسبه می‌شود [۱۱]:

$$g(E) = \frac{g_0}{2\pi Et} \sum_{i,j} \int_0^\infty \frac{\frac{\pi}{\Gamma} f_{dip}(k_t) M_b (f_j - f_i) d^2 k_t}{1 + \frac{(E_{cj}(k_t) - E_{kpi} - E)^2}{\Gamma^2}} \quad (4)$$

که t ضخامت چاه کوانتمویی و $\Gamma / \tau_{scat} = \hbar / \tau_{scat}$ پهن شدگی ناشی از زمان واهلش پراکندگی بین نواری E_{cj} است. نشان دهنده j امین زیر نوار باند هدایت است و E_{kpi} نیز i امین زیرنوار باند ظرفیت در محاسبه‌ی $k.p$ است. جمع بندی بر روی زیرنوارهای هدایت و ظرفیت است. $g_0 = \pi q^2 \hbar / \epsilon_0 c m_0^2 n$ ثابتی با تمام نمادهایی هست که دارای معانی معمول خود هستند. M_b ممان دو قطبی نام دارد [۱۱]. کار بر روی چاههای کوانتمویی کرنش یافته^۷ با استفاده

¹ Poisson's Equation

² Current Continuity

³ Stimulated Recombination

⁴ Spontaneous Recombination

⁵ Auger Recombination

⁶ Interband Transition

⁷ Strained Quantum Well

از نظریه‌ی k.p انجام می‌شود، اثرات آمیختگی نوار ظرفیت^۱ در نظر گرفته شده است و زیرنوارهای چاه کوانتمومی برای محاسبه‌ی غلظت‌های حامل و بهره‌ی نوری با قطعی سازی هامیلتونین لوتینگر-کون^۲ در تقریب چهار نواری حل می‌شوند [۱۲]:

$$\begin{pmatrix} P+Q & -S & R & 0 \\ -S^* & P-Q & 0 & R \\ R^* & 0 & P-Q & S \\ 0 & R^* & S^* & P+Q \end{pmatrix} \quad (5)$$

با

$$P = \frac{\hbar^2}{2m_0} \gamma_1 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) + P_\varepsilon + E_v(z),$$

$$Q = \frac{\hbar^2}{2m_0} \gamma_2 (k_x^2 + k_y^2 - 2k_z^2) + Q_\varepsilon,$$

$$S = \sqrt{3} \frac{\hbar^2}{m_0} \gamma_3 k_z (k_x - ik_y),$$

$$R = \sqrt{3} \frac{\hbar^2}{2m_0} (\gamma_2 (k_x^2 - k_y^2) - 2\gamma_3 k_x k_y), \quad (6)$$

$$P_\varepsilon = -a_v (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}),$$

$$Q_\varepsilon = -\frac{b}{2} (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} - 2\varepsilon_{zz}),$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{a_{st} - a_0}{a_0},$$

$$\varepsilon_{zz} = -2 \frac{C_{12}}{C_{11}} \varepsilon_{xx},$$

که \hbar ثابت پلانک است که بر 2π تقسیم می‌شود و m_0 جرم آزاد الکترون است، γ_1 ، γ_2 و γ_3 به ترتیب پارامترهای لاتینگر^۳ هستند و k_x ، k_y و k_z به ترتیب مولفه‌های بردار موج هستند، $E_v(z)$ پتانسیل محدودسازی^۴ در نوار ظرفیت است، ε_{ij} عبارت است از مولفه‌های تابع کرنش^۵، a_v و b پتانسیل‌های تغییر شکل^۶ هستند، C_{ij} ثابت‌های الاستیک

¹ Valence Band Mixing

² Luttinger_Kohn Hamiltonian

³ Luttinger

⁴ Confinement Potential

⁵ Strain Tensor

⁶ Deformation Potentials

هستند، a_0 و a_{st} ثابت‌های شبکه به ترتیب برای ساختارهای غیر کرنشی و کرنش یافته هستند. R^* و S^* به ترتیب مزدوج هرمیتی S_k و R_k هستند و با تغییر علامت بخش موهومی i حاصل می‌شوند. در مدل حرارتی، از نقطه نظر تئوری، مساله‌ی ما شامل حل معادله‌ی شارش حرارتی است [۱۲]:

$$C_L \rho_L \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot K_L \nabla T + H_{heat} \quad (7)$$

که حرارت ویژه‌ی شبکه بلوری و H_{heat} منابع تولید گرما هستند. ρ_L و K_L به ترتیب چگالی ماده و هدایت گرمایی را نشان می‌دهند. می‌توان منابع گرمایش را به گرمای ژول^۱، گرمای تولید و بازترکیب^۲، گرمای جذب^۳ و گرمای تامسون^۴ تقسیم کرد [۱۲].

اکثر پارامترهایی که در شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفتند، مقادیر استانداری حاصل از مرجع [۱۲] هستند. ضرایب بازترکیب خودبخودی و اوژه به ترتیب برابر هستند با $B = 2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3 \text{ S}^{-1}$ و $C_n = C_p = 2 \times 10^{-43} \text{ cm}^3 \text{ S}^{-1}$. سطوح مقطع ناشی از جذب توسط الکترون‌های آزاد و حفره‌ها (متناسب با چگالی‌های حامل مربوطه) به ترتیب برابر با $a_n = 4 \times 10^{-18} \text{ cm}^3$ و $a_p = 12 \times 10^{-18} \text{ cm}^3$ هستند. چگالی‌های موثر حالت‌های چاه‌های کواتومی از روی محاسبه‌ی کواتوم-مکانیکی حاصل می‌شوند. در شبیه‌سازی حرارتی، فرض بر این است که اتصال پایینی دارای دمای شبکه و اتصال بالایی دارای جریان توان حرارتی پیش‌رونده باشد. ضریب انتقال حرارت در اتصال- p برابرا صفر است. دمای شبکه مجهول است که با حل معادله‌ی شارش حرارتی به دست می‌آید. ضرایب رسانش گرمایی بصورت تقریبی با در نظر گرفتن اثرات ترکیب آلیاژ و پراکنش رابطه‌ی فونون بر روی رسانش حرارتی تخمین زده می‌شوند. K_L برای لایه‌های نیمه رسانای $Al_xGa_{1-x}(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$ و W/Kcm ۶ در نظر گرفته شده است [۱۳].

موبیلیتی^۵ حامل یک پارامتر مادی کلیدی در شبیه‌سازی انتقال حامل‌ها است. از تقریب توماس^۶ برای تخمین موبیلیتی به عنوان تابعی از چگالی حامل استفاده شده است [۱۲]:

$$\mu(N) = \mu_{min} + \frac{\mu_{max} - \mu_{min}}{1 + (\frac{N}{N_{ref}})^{\alpha}} \quad (8)$$

که μ_{max} بیشینه موبیلیتی (بدون ناخالصی) و μ_{min} کمینه موبیلیتی برای چگالی‌های ناخالصی بالا است. پارامترهای موبیلیتی برای $Al_xGa_{1-x}AS$ و $Al_xGa_{1-x}(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$ در جدول ۱ و ۲ نشان داده شده‌اند.

¹ Joule Heat

² Generation / Recombination Heat

³ Absorption Heat

Heat⁴ Thomson

⁵ Mobility

⁶ Thomas Approximation

جدول ۱. پارامترهای موبیلیتی $(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$

α	N_{ref}	μ_{max}	μ_{min}	پارامتر واحد
-	$m^{-\tau}$	$m^{-\tau}V^{-1}S^{-1}$	$m^{-\tau}V^{-1}S^{-1}$	
.43	5×10^{-17}	.15	.	الكترون‌ها
.397	2.7×10^{-17}	.0397	.	حفره‌ها

جدول ۲. پارامترهای موبیلیتی $Al_xGa_{1-x}AS$

α	N_{ref}	μ_{max}	μ_{min}	پارامتر واحد
-	$m^{-\tau}$	$m^{-\tau}V^{-1}S^{-1}$	$m^{-\tau}V^{-1}S^{-1}$	
.436	1.69×10^{-17}	.85	.	الكترون‌ها
.395	2.75×10^{-17}	.4	.	حفره‌ها

برای سیستم ماده‌ی $P(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}$ ، پهنه‌ای گاف نواری با استفاده از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود [۱۳]:

$$E_g((Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}) = 4.07 + 0.5 \times (1.425 - (1.9 + 0.6x)) \quad (9)$$

: $Al_xGa_{1-x}As$ و برای

$$E_g(Al_xGa_{1-x}As) = 1.9 + 0.125x + 0.143x^2 \quad (10)$$

ضریب شکست $Al_xGa_{1-x}P$ برای لایه‌های مختلف در لیزر با استفاده از روابط زیر محاسبه می‌شود [۱۲]:

$$n_r = 3.65 - 0.37x \quad (11)$$

: $Al_xGa_{1-x}As$ و برای لایه‌های

$$n_r = 3.65 - 0.73x . \quad (12)$$

در این تحقیق، پارامترهای مربوطه برای محاسبه بهره نوری و ساختار نواری سیستم‌های مادی $(\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ و $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ از درون‌یابی خطی^۱ مقادیر ترکیبات نیمه رسانای دوتایی به دست آمده اند. پارامترهای مادی ترکیبات نیمه رسانای دو تایی بر در جدول ۳ ارائه شده‌اند.

جدول ۳. پارامتر ماده نیمه‌هادی دوتایی بکار رفته در این تحقیق

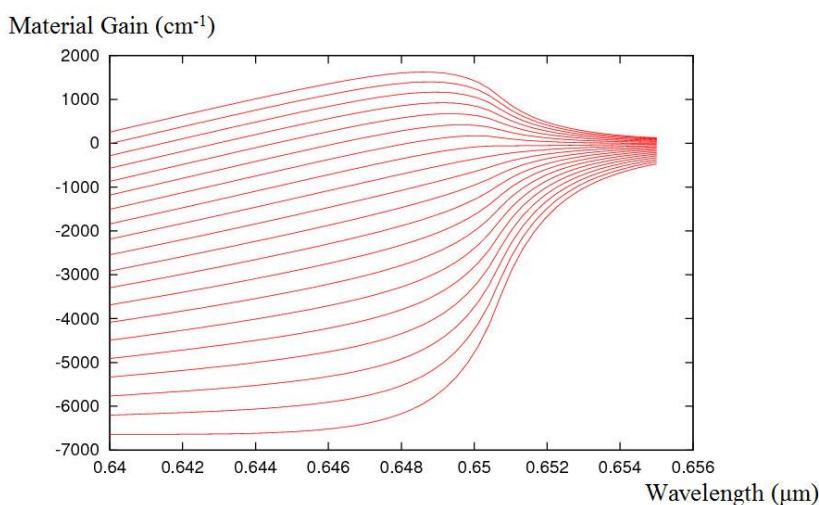
InP	AlAs	InAs	GaAs	واحد	پارامتر
۰,۰۶۴	۰,۱۵	۰,۰۲۷	۰,۰۶۵	m_0	m_c
۶,۳۵	۳,۷۵	۱۹,۶۷	۶,۸۵	-	γ_1
۲,۰۸	۰,۸۲	۸,۳۷	۲,۱	-	γ_2
۲,۷۶	۱,۴۲	۹,۳۹	۲,۹	-	γ_3
۵,۸۶۹	۵,۶۶۱۱	۶,۰۵۸	۵,۶۵۳۲۵	Å	a_0
۱۰۲۲	۱۲۵۰	۸۳۲۹	۱۱۸۱	GPa	C_{II}
۵۷۹	۵۴۳	۴۵۲,۶	۵۳۲	GPa	C_{I2}
۰,۶	۲,۴۷	۱	۱,۱۶	eV	a_v
-۲	-۲,۳	-۱,۸	-۲	eV	B

۴- نتایج شبیه‌سازی و بحث

برای حصول اطمینان از اینکه ترکیب و ضخامت چاه‌های کوانتمویی برای تولید طول موج مطلوب مناسب هستند، ابتدا بهره نوری بررسی می‌شود. محاسبه‌ی بهره با استفاده از PICS3D در شکل ۲ ارائه شده است. غلظت حامل‌های موجود در چاه‌های کوانتمویی برای محاسبه‌ی بهره نوری به ترتیب برای پایین‌ترین و بالاترین منحنی در باز m^{-3} $5 \times 10^{-23} \text{ m}^{-3}$ تا $5 \times 10^{-24} \text{ m}^{-3}$ قرار دارد. باید خاطر نشان شود که با انتخاب درست پارامترهای مادی بکار رفته در شبیه‌سازی‌ها، می‌توان طول موج لیزر دهی افزارهای پیشنهاد شده را با دقت چندین نانومتر پیش بینی کرد. شکل ۲ تایید می‌کند که به دلیل بهره‌ی مثبت چاه‌های کوانتمویی در لیزرهای پیشنهاد شده در بازه‌ی طول موج بین $0,655 \mu\text{m}$ تا $0,664 \mu\text{m}$ این ادوات در محدوده طول موجی ذکر شده فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، ترکیب و ضخامت چاه

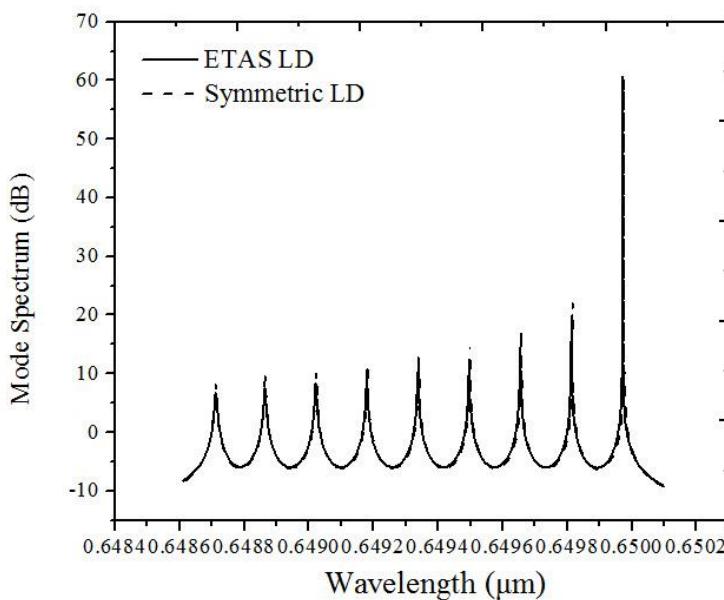
^۱ Linearly Interpolated

های کوانتوسی برای فعالیت در طول موج قرمز مناسب هستند. بیشینه بهره‌ی به و محدوده‌ی طول موج به دست آمده از این نمودار تطابق مناسبی با مرجع [۱۴] دارد.



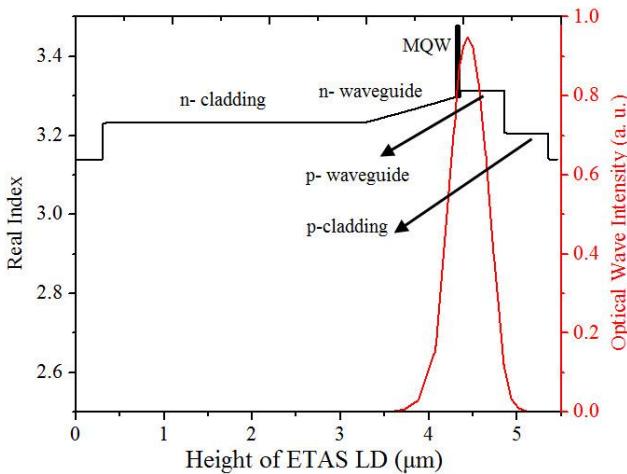
شکل ۲. بهره محاسبه شده چاه‌های کوانتوسی

با توجه به مراجع مختلف و نمونه‌های تجاری موجود، طیف‌های مدی مربوط به دو ساختار پیشنهادی در جریان تزریقی 200 mA و دمای زمینه 20°C در شکل ۳ نشان داده شده‌اند. این شکل فعالیت لیزرهای ETAS و متقارن را در طول موج 6500 nm ثابت می‌کند. این بدان معناست که موجبر ETAS پیشنهادی طول موج خروجی لیزر را تغییر نمی‌دهد.



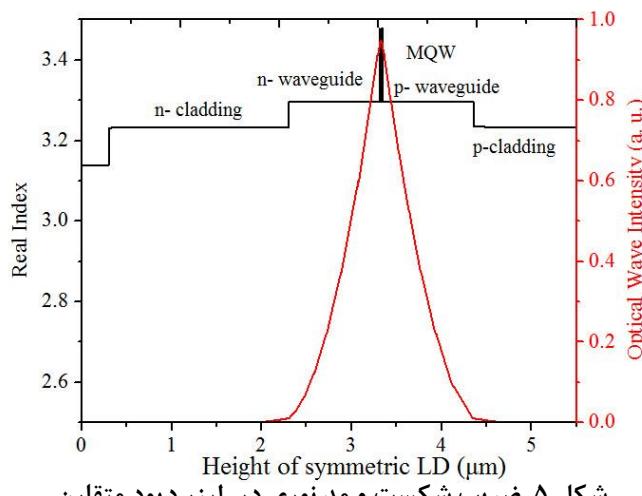
شکل ۳. طیف‌های مد لیزر متقارن و لیزر ETAS در 200 mA و دمای زمینه 20°C

نمودارهای ضریب شکست و شدت نوری محاسبه شده‌ی مد اصلی به ترتیب در شکل‌های ۴ و ۵ برای لیزر دیودهای ETAS و متقارن نشان داده شده‌اند. بیشینه شدت موج نوری در طرح موجبر متقارن دقیقاً در محل چاه‌های کوانتمومی قرار گرفته است و این در حالی است که بیشینه شدت ETAS به طرف سمت p جابجا شده است. این بدان معناست که ضریب محدودیت نوری^۱ طرح جدید کاهش می‌یابد. لذا، انتظار می‌رود که عملکرد لیزر دیود (LD) تحریب شود. در لیزرهای نیمه رسانا محدود سازی مد نوری در ساختار موجبر توسط اختلاف ضریب شکست بین لایه‌های غلاف و موجبر تعیین می‌شود. هرچقدر اختلاف بین ضرایب شکست کوچک‌تر باشد، مد با قدرت بیشتری در لایه‌های غلاف نفوذ می‌کند.



شکل ۴. نمودار ضریب شکست و مد نوری در لیزر دیود ETAS

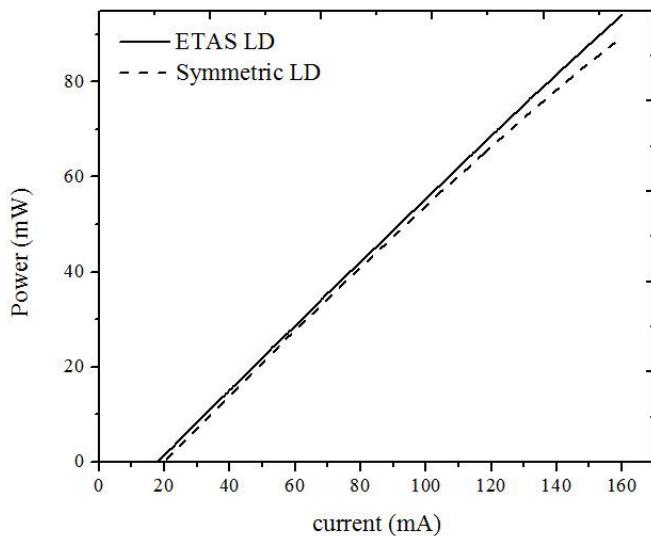
همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است، به خاطر اختلاف ضریب شکست کوچک‌تر بین لایه‌های پوشش و موجبر نوع n و نوع p، نفوذ مد نوری در لایه‌هایی با ناخالصی بالا و در نتیجه اتلاف نوری منتجه در لیزر دیود متقارن افزایش می‌یابد. افزایش اتلاف نوری موجب افزایش جریان آستانه و کاهش توان خروجی لیزر دیود متقارن می‌شود. نمودارهای نمایش داده شده در شکل‌های ۴ و ۵ همخوانی مناسبی با نمودارهای مشابه در مرجع [۱۵] دارند.



شکل ۵. ضریب شکست و مد نوری در لیزر دیود متقارن

^۱ Optical Confinement Factor

شکل ۶ این ایده را تایید می کند. مشخصه هی توان - جریان شبیه سازی شده برای لیزر دیود^۱ های با ساختار موجبر ETDAS و ساختار متقارن در دمای زمینه 20°C در شکل ۶ مقایسه شده است. جریان های آستانه برای لیزرهای ETDAS و متقارن به ترتیب برابر با $17,7\text{ mA}$ و 20 mA هستند. یعنی جریان آستانه تقریبا 2 mA کاهش می یابد. توان خروجی از $89,9\text{ mW}$ برای لیزر دیود متقارن به $94,7\text{ mW}$ برای لیزر دیود ETDAS در 200 mA افزایش می یابد.



شکل ۶. مشخصه هی توان - جریان شبیه سازی شده برای ساختارهای متقارن و ETDAS در دمای زمینه 20°C

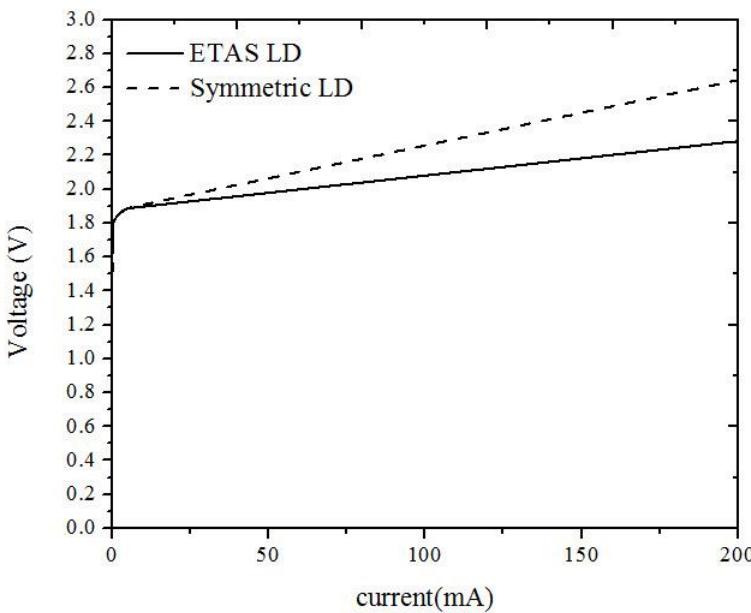
بازده شیب^۲ ویژگی مهم لیزرهای نیمه رسانا است. این ویژگی در صد الکترون های تزریقی بالاتر از آستانه ای را نشان می دهد که در تولید فوتون برای ایجاد پرتوی لیزر شرکت می کند [۱۲]. این ویژگی با رسم توان خروجی دیود لیزری به ازای جریان تزریقی حاصل می شود. بالاتر از جریان آستانه، همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است، منحنی منتجه معمولاً نزدیک به خط صاف است. بازده شیب برابر با شیب این خط است. بازده شیب نیز محاسبه می شود که از $\text{W/A} = 62,6\text{ W/A}$ برای لیزر دیود متقارن به $65,6\text{ W/A}$ برای لیزر دیود ETDAS افزایش یافته است و این یک بهینگی برای هر لیزری محسوب می شود. نمودار توان - جریان به دست آمده در این شبیه سازی توسط مطالعات تجربی مراجع [۱۵ و ۱۶] قابل تایید است.

شکل ۷ ولتاژ لیزر دیودهای متقارن و ETDAS را به ازای جریان تزریقی نشان می دهد. در رابطه با منحنی های ولتاژ - جریان، ولتاژ آستانه لیزر دیود ETDAS کمتر از لیزر دیود متقارن است. ولتاژ های آستانه به ترتیب برای لیزر دیود متقارن و لیزر دیود ETDAS برابر با $V = 1,95$ و $V = 1,99$ هستند. همچنین می توان مقاومت سری را از روی

^۱ Laser Diode

^۲ Slope Efficiency

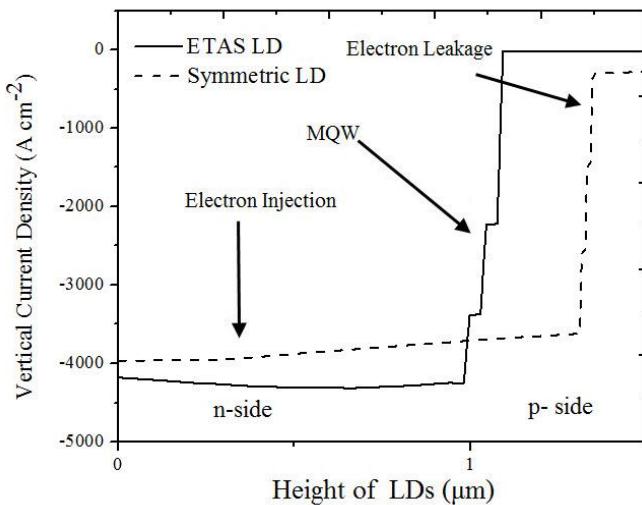
شیب منحنی‌های ولتاژ- جریان محاسبه کرد که این مقاومت از $\Omega_{4,7}$ برای لیزر دیود متقارن به $\Omega_{3,8}$ برای لیزر دیود ETDAS کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، مقاومت سری لیزر دیود ETDAS به اندازه‌ی $\Omega_{1,1}$ کمتر از لیزر دیود متقارن است. این بدان معناست که عملکرد لیزر دیود ETDAS تا حد زیادی بهبود می‌یابد.



شکل ۷. نمودارهای ولتاژ- جریان شبیه‌سازی شده برای ساختارهای متقارن و ETDAS در دمای زمینه 20°C

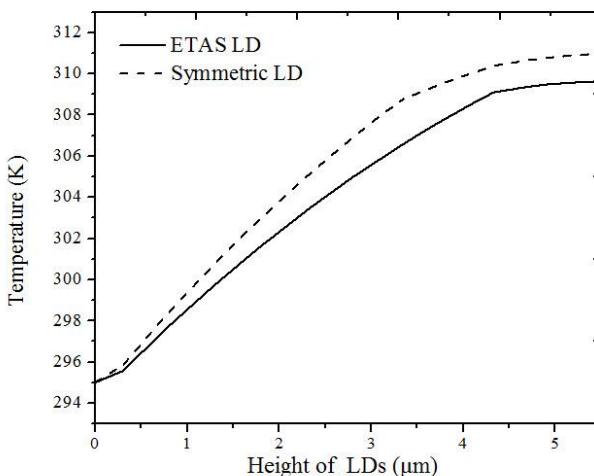
دلیل افزایش توان خروجی لیزر دیود ETDAS از روی شکل ۸ قابل درک است. توزیع عمودی چگالی جریان الکترون در ساختار متقارن و ETDAS در 200 mA در این شکل نشان داده شده است. در لیزرهای نیمه رسانا، الکترون هایی که توسط چاه محدود نشده‌اند احتمالاً به ناحیه‌ی نوع p نشست کرده و جریان نشتی الکترون^۱ را شکل خواهند داد. هرگاه الکترون‌ها از لایه‌های سمت n به چاه‌های کوانتموی تزریق شوند، با حفره‌های موجود در آنجا بازترکیب شده و چگالی جریان الکترون در هر چاه کوانتموی کاهش پیدا می‌کند [۱۷]. همانطور که در شکل ۸ مشخص است، چگالی جریان الکترون در ساختار ETDAS بزرگ‌تر از ساختار متقارن در چاه‌های کوانتموی در سمت n لیزر است، چگالی جریان الکترون در ساختار ETDAS بازترکیب شده است. این بدان معناست که الکترون‌های بیشتری با حفره‌ها در چاه‌های کوانتموی در ساختار ETDAS در مقایسه با لیزر دیود متقارن بازترکیب می‌شوند. به خاطر بازترکیب موثرتر الکترون‌ها و حفره‌ها در ناحیه‌ی فعال لیزر ETDAS، بازترکیب القایی ساختار نامتقارن افزایش می‌یابد. افزایش بازترکیب القایی به این معنی است که الکترون‌ها و حفره‌های بیشتری در تولید فوتون شرکت خواهند کرد و بدین ترتیب توان خروجی نیز افزایش پیدا می‌کند.

^۱ Electron Leakage Current



شکل ۸. چگالی جریان الکترون شبیه‌سازی شده بر حسب ارتفاع برای ساختارهای متقارن و ETDAS در جریان تزريقی 200 mA و دمای زمینه 20°C

پارامتر مهم دیگر در عملکرد دیودهای لیزر توان بالا عبارت است از بهینه‌سازی ویژگی‌های حرارتی لیزر. به طور خاص، بهینه‌سازی هندسه‌ی لیزر برای دستیابی به عملکرد توان بالا معیار مهمی در طراحی آن است. دماهای مربوط به ساختارهای متقارن و نامتقارن بر حسب ارتفاع افزاره‌هادر شکل ۹ نشان داده شده است. همانطورکه مشاهده می‌شود، دمای ساختار ETDAS تقریباً تا 14 K افزایش می‌یابد که کمتر از نوع متقارن در همان جریان است. این امر به خاطر پایین بودن مقدار جذب نوری و برداشت گرمایی موثر تر در ساختار نامتقارن است. دلیل اصلی برای جذب نوری پایین تر همپوشانی کمتر مد اصلی با لایه‌های بالای غلاف و موجبر است.

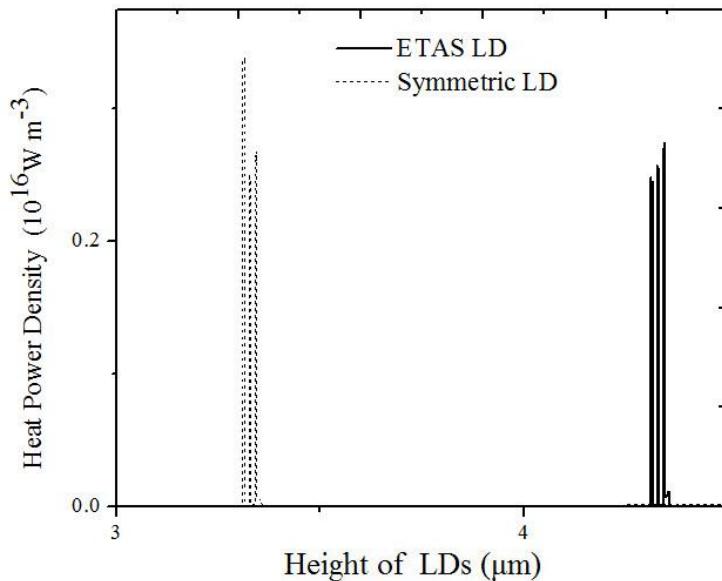


شکل ۹. نمودارهای دمایی محاسبه شده بر حسب ارتفاع برای ساختارهای متقارن و ETDAS در جریان تزريقی 200 mA و دمای زمینه 20°C

برای کنترل خودگرمایش^۱ لیزر، حرارت تولیدشده در لیزر باید بصورت کارآمدی انتقال داده شود. گرمای تولید شده در ناحیه‌ی فعال با جذب حامل آزاد یا بازترکیب غیرتابشی ممکن است بهره، بازده شیب و توان خروجی را کاهش داده و

¹ Self- Heating

عملکرد لیزر را تخریب کند. به همین دلیل، کنترل حرارت در بهبود عملکرد لیزر بسیار مهم است. مقاومت حرارتی پایین به این معناست که لیزر می‌تواند گرمای تولید شده را بصورت کارآمدتری انتقال دهد و افزایش دما در ناحیهٔ فعال کمتر خواهد بود [۱۸].



شکل ۱۰. چگالی توان حرارتی بر حسب ارتفاع برای ساختارهای متقارن و ETDAS در جریان تزریقی ۲۰۰ mA و دمای زمینه ۲۰°C

شکل ۱۰ چگالی توان حرارتی را در دستگاه‌هادر جریان تزریقی ۲۰۰ mA و دمای زمینه ۲۰°C نشان می‌دهد. همانطورکه در این شکل نشان داده شده است، توان حرارتی تولیدی در ناحیهٔ فعال لیزر دیود ETAS کمتر از لیزر دیود متقارن است. به همین دلیل، دمای ساختار نامتقارن افزایش کمتری می‌یابد. نتایج و دلایل به دست آمده از این مطالعه، تطابق مناسبی با نمونه‌های ساخته شده موجود در مراجع [۱۹] و [۲۰] دارد.

نتیجه‌گیری

بهطور خلاصه، برای اولین بار، موجبر متقارن سه‌گانه‌ی اکستریم معرفی و در دیود لیزری قرمز مبنی بر InGaAlP بکار گرفته شده است. در ساختار موجبر پیشنهادی ETDAS جدید، در گام نخست، ضخامت لایه‌های موجبر نوع n و غلاف نوع n افزایش داده شد و سپس تقارن سه‌گانه در طراحی لایه‌های موجبر و غلاف نوع n و نوع p در ساختار موجبر لیزر در نظر گرفته شد. عملکرد ساختارهای لیزر مرسوم و پیشنهادی جدید از نظر تئوری با استفاده از نرم افزار PICS3D مطالعه شد. این نرم افزار شبیه‌سازی‌های سه بعدی انتقال حامل، موجبری نوری و خودگرمایشی را به صورت خودسازگار ترکیب می‌کند. نتایج شبیه‌سازی نشان دادند که عملکرد ساختار پیشنهادی در مقایسه با ساختار متقارن مرسوم تا حد زیادی بهبود یافته است. لیزر نیمه رسانا با ساختار جدید نامتقارن سه‌گانه‌ی اکستریم دارای

حریان آستانه و مقاومت سری کاهش یافته، توان خروجی و بازده شبیه افزایش یافته و پایداری حرارتی بهبود یافته است. که تمام این خصوصیات در عملکرد توان بالا اهمیت بسزایی دارند.

تشکر و قدردانی

تشکر ویژه‌ی خود را نثار مدیران شرکت Cross Light. می‌کنم که برنامه‌ی شبیه‌سازی پیشرفته‌ی PICS3D (نسخه ۱۲، ۲۰۰۸) را به صورت آنلاین در اختیار دانشگاه گیلان قرار دادند.

منابع

1. Frevert C., "Optimization of broad-area GaAs diode lasers for high powers and high efficiencies in the temperature range 200-220 K", Doctoral thesis (2018).
2. Hiroyama R., Inoue D., Kameyama S., Tajiri A., Shono M., Sawada M. , Ibarak A., "High-Power 200mW 660nm InGaAlP Laser Diodes with Low Operating Current", Jpn. J. Appl. Phys., 43, No. 4B (2004) 1951- 1955.
3. Ryvkina B. S., Avrutinb E. A., "Asymmetric, nonbroadened large optical cavity waveguide structures for high-power long-wavelength semiconductor lasers", J. Appl. Phys., 97, (2005) 123103 .
4. Buda M., Roer van de T. G., Kaufmann L. M. F., Iordache Gh., Cengher D., Diaconescu D., Petrescu-Prahova I. B., Haverkort J. E. M., Van der Vleuten W., Wolter J. H., "Analysis of 6-nm AlGaAs SQW low-confinement laser structures for very high-power operation", IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron, 3, (1997) 173-179.
5. Ryvkina B. S., Avrutinb E. A., "Improvement of differential quantum efficiency and power output by waveguide asymmetry in separate-confinement-structure diode lasers", IEE Proceedings - Optoelectronics, 151, (2004) 232-236.
6. Crump P., Erbert G., Wenzel H., Frevert C., Schultz C. M., Hasler K. H., StaskeR., Sumpf B., Maaßdrof A., Bugge F., Knigee, S. , Trankle G., "Efficient High-Power Laser Diodes", IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron, 19 (2013) 1501211-1501211.
7. Edwards Rees P., "Characterisation of the waveguide dependence of optical mode loss in semiconductor lasers", Doctoral thesis, Cardiff University (2017).

8. Koziol Z., Matyukhin S. I., "The effects of multiply quantum wells (MQW) on optical and electrical characteristics of AlGaAs lasers with separate confinement heterostructures (SCH)", <https://www.researchgate.net/publication/51934551> (2011).
9. Available online at www.crosslight.com.
10. Xia M., Ghafouri Shiraz H., " Analysis of carrier heating effects in quantum well semiconductor optical amplifiers considering holes' Non-parabolic density of states", Optic. Quantum Electron. 47 (2015) 1847-1858.
11. Hsieh D. H., Tzou A. J., Kao T. S., Lai F. I., Lin D. W., Lin B. C., Lu T. C., Lai W. C., Chen C. H. , Kuo H. C., "Improved carrier injection in GaN-based VCSEL via AlGaN/GaN multiple quantum barrier electron blocking layer", Optic. Express, 23 (2015) 27145.
12. Piprek J., "Semiconductor Optoelectronic Devices: Introduction to Physics and Simulation", Academic Press San Diego, (2003).
13. Martin O. J. F., Bona G.-L., Wolf P., "Thermal Behavior of Visible AlGaInP-GaInP Ridge Laser Diodes", IEEE J. Quantum Electron, 11, (1992) 2582-2588.
14. Dumitrescu M. , Toivonen M. , Savolainen P., Orsila S., Pess M.a, "High-power edge emitting red laser diode optimisation using optical simulation", Opt. Quantum Electron, 31 (1999) 1009-1030.
15. Hiroyama, R., Inoue, D., Kameyama, S., Tajiri, A., Shono, M., Sawada, M., Ibaraki, A., "High-Power 200mW 660nm AlGaInP Laser Diodes with Low Operating Current", Jpn. J. Appl. Phys, 43, (2004)1951–1955.
16. H. Sumitomo, S. Kajiyama, H. Oguri, T. Sakashita, K. Nakao, Y. Yamamoto, T. Kita, T. Komatani, H. Kawakubo, M. Ono, and S. Izumi, "High-Power Short-Cavity AlGaInP Laser Diodes", Technical Review, 70,(2010) 79-83.
17. Xiang L., Degang Z., Desheng ., Ping C., Zongshun L., Jianjun Z., " Suppression of electron leakage in 808 nm laser diodes with asymmetric waveguide layer ", J. Semicond., 37 (2016) 014007.
18. Zhang Y., "Self-heating control of edge emitting and vertical cavity surface emitting lasers", Doctoral Dissertation, University of Central Florida ,(2014).

19. Hallman L. W. , Ryvkin B. S. , Avrutin E. A. , Aho A. T. , Jukka V. , Juhat M. G. , Kostamovaara T. , "High Power 1.5 μ m Pulsed Laser Diode with Asymmetric Waveguide and Active Layer Near p-cladding", IEEE Photon. Tech. Let.: 31, (2019) 1635-1638.
20. Kaul T., Erbert G., Maaßdorf A., Martin D. , Crump P., "Extreme triple asymmetric (ETAS) epitaxial designs for increased efficiency at high powers in 9xx-nm diode lasers", Conference: High-Power Diode Laser Technology XVI (2018).

Optimization of AlGaInP-based semiconductor laser performance by introducing extreme triple asymmetric waveguide structure

Zahra Danesh Kafroudi

Department of Engineering sciences, Faculty of Technology and Engineering East of
Guilan, University of Guilan, Rudasr, Vajargah, Iran

Abstract

In this paper, for the first time, improved lasing performance of a red AlGaInP laser diode is demonstrated by introducing a new extreme triple asymmetric waveguide structure. In the new proposed waveguide structure, at the first step, n-waveguide and n- cladding layer thicknesses are increased and then, a triple asymmetry is introduced on the design of the n-type and p-type cladding and waveguide layers inside the red laser diode structure. The conventional symmetric and the new extreme triple asymmetric laser structures performances are theoretically investigated using simulation software PICS3D. 3D simulations of carrier transport, optical waveguiding and self-heating are combined self-consistently in the software. Numerical results show that the new proposed structure performance is significantly improved in comparison to the conventional symmetric structure. The reasons of improvements are discussed in this investigation. The simulation results show that the use of the new structure reduces the overlap of the optical mode with of high doping regions. On the other hand, by reducing the electron leakage current, an increase in the stimulated recombination rate occurs, which leads to a decrease in the threshold current and an increase in the output power. By reducing the series resistance and increasing the thermal stability of the new proposed structure, the optimality of this structure is confirmed.

Keywords: AlGaInP- based laser diode, Simulation, Power, Threshold current, Extreme triple asymmetric waveguide, PICS3D.